(54) DECORATED TEMPERED FLAT GLASS AND PRODUCTION THEREOF

(11) 3-159930 (A) (43) 9.7.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 64-296410 (22) 14.11.1989

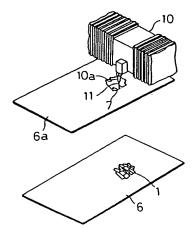
(71) FUJI HAADOUEAA K.K. (72) HISAO HIRASAWA

(51) Int. Cl⁵. C03B33/00,C03B27/012

PURPOSE: To prevent cracking of sheet glass, reduce falling of decoration and improve finish accuracy by fitting a decorative unit in a through-hole of a shape in proportion to the decorative unit formed in green sheet glass using a water jet.

a water jet.

CONSTITUTION: A through-hole 7 of a shape in proportion to that of a decorative unit is formed in green sheet glass (6a) using a water jet 11. The resultant raw sheet glass (6a) having the through-hole 7 formed therein is then subjected to tempering treatment to provide a tempered sheet glass 6. The decorative unit 1 is simultaneously fitted in the aforementioned through hole 7 to afford the objective decorated tempered sheet glass.



(54) METHOD FOR MULTIPLE DIVISION OF WORKPIECE SUCH AS THICK SHEET GLASS

(11) 3-159931 (A)

(43) 9,7.1991 (19) JP

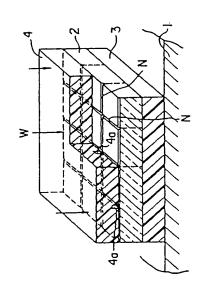
(21) Appl. No. 64-298279 (22) 16.11.198#

(71) KAZUO SATO(1) (72) KAZU SATO(1)

(51) Int. Cl5. C03B33/02

PURPOSE: To readily obtain square or triangular plates or cubes from thick sheet glass by applying a pressure to compressing plates laminated to both sides of a workpiece to be divided, causing pulling and bending in the workpiece, maximizing the stress thereof in streak parts and dividing the aforementioned sheet glass.

CONSTITUTION: Speaks (N) of a shape to be divided are preformed on the surface of a workpiece 2 such as thick sheet glass. A compressing plate 4 is then superposed of the surface provided with the streaks (N) of the above-mentioned workpiece 2. The aforementioned compressing plate 4 has a lower Young's modulus than that of the above-mentioned workpiece 2 to form small holes (4a) at positions corresponding to points crossing the aforementioned streaks (N). The second compressing plate 3 is then superposed through a lubricant on the other surface of the above-mentioned workpiece 2 to apply a pressure (W) to both the compressing plates 3 and 4. The workpiece 2 such as thick sheet glass is subsequently divided in the whole vertical cross sections along the streaks (N).



(54) APPARATUS AND METHOD FOR DEHYDRATING AND SINTERING CELLULAR HIGH-PURITY QUARTZ PREFORM

(11) 3-159932 (A)

(43) 9.7.1991

(19) JP

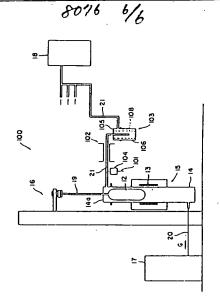
(21) Appl. No. 64-293946 (22) 14.11.1989

(71) SUMITOMO ELECTRIC IND LTD (72) ICHIRO TSUCHIYA(4)

(51) Int. Cl5. C03B37/014,G02B6/00

PURPOSE: To stabilize a dehydrating and sintering process without clogging the interior of a vent pipe with powder by decomposing SiCl₄ in a waste gas before treating thereof in a waste gas treating part, converting the SiCl₄ into SiO₂ powder and removing the resultant SiO₂ powder.

CONSTITUTION: A cellular high-purity quartz preform 12 is heated with a heating element 13 while introducing an atmospheric gas (G) containing SiCl, into a furnace core tube 14, then dehydrated and sintered. The SiCl, in the atmospheric gas discharged from the furnace core tube 14 is simultaneously heated together with humidified atmospheric air introduced from an atmospheric air introduction part 101 with a heating means 102, oxidized or hydrolyzed and converted into SiO₂ powder, which is then collected and removed in a dust collecting part 103. The atmospheric gas is subsequently treated in a waste gas treating part 18



®日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-159932

®Int. CI. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)7月9日

C 03 B 37/014 G 02 B 6/00

Z A 356

8821-4G 7036-2H

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

60発明の名称

多孔質高純度石英母材の脱水焼結装置及び多孔質高純度石英母材の 脱水烧結方法

②特 頤 平1-293946

> 23出 颐 平1(1989)11月14日

⑫発 明 者 屋 土

者

郎

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

明

⑫発

E

斉

秀

真

横浜製作所内

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

勿発 叫 *

金 杰

弘 雄 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

⑪出 願 人

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜 4丁目 5番33号

個代 理 人

弁理士 光石 英俊 外1名

最終頁に続く

W)

1.発明の名称

多孔質高純度石英母材の脱水焼結装置及び多 孔質高純度石英母材の脱水焼結方法

2. 特許請求の範囲

1) 光ファイバ用の多孔質高純度石英母材を脱 水焼結する発熱体及び炉芯管を有する炉本体 と、この炉芯管内に雰囲気ガスを供給するガ ス供給部と、この炉芯管より排出される魔が スを処理する腐ガス処理部とを具備する多孔 質高純度石英母材の脱水焼結装置において、

炉本体と廃ガス処理部とを連結する接続手 段に、大気を導入する大気導入部と、この大 気導入部から導入した大気及び廃ガスを加熱 する加熱手段と、魔ガス中の反応により生成 した粉体を収集する集盛部とを設けてなると とを特徴とする多孔関高純度石英母材の脱水 烧粘装置。

2) 請求項1記載の多孔質高純度石英母材の脱

水焼紡装置において、

大気導入部に加湿手段を設けてなり、導入 された大気を加湿することを特徴とする多孔 質高純度石英母材の脱水焼結装置。

3) 炉芯管内にSiCe を含む雰囲気ガスを導入 しつつ多孔質高純度石英母材を加熱して脱水 焼結すると共に、炉芯管より排出される廃ガ スを処理する多孔質高純度石英母材の脱水焼 結方法において、

上記脱水焼結反応により炉芯管から排出さ れるSiСしを含む雰囲気ガスを廃ガス処理 部で処理する以前に、該排出雰囲気ガス中の SiCleを酸化又は加水分解させてSiO。粉 体とした後、このSiOa粉体を収逸除去する ことを特徴とする多孔質高純度石英母材の脱 水烧粘方法。

3. 発明の詳細な説明

く産業上の利用分野>

本発明は、光ファイバ用の多孔質高純度石 英母材の脱水焼結時における炉芯管からの腕 ガスを効率よく処理する多孔質高純度石英母 材の脱水焼箱装置及び多孔質高純度石英母材 の脱水焼箱方法に関する。

く従来の技術>

光ファイバ用母材を大量生産する一般的な方法として、VAD(Vapor Phase Axial Deposition)法が知られている。このVAD法は、回転する例えばガラス棒等出発材の上に、酸水素炎中で生成した例えばSiO。等のガラス微粒子を堆積させて円柱状の多孔質高純度石英母材(スート母材)をつくる方法をいい、このスート母材を脱水焼結して透明な光ファイバ用ガラス母材を製造している。

ての従来の多孔與高純度石英母材の脱水焼 結装置(以下「脱水焼結装置」という。)の 一例を第3回に示す。同図において、脱水焼 結装置11はスート母材12を加熱する発熱 体13及び炉芯管14を育する炉本体15と、 スート母材12を回転支持界降させる昇降手 段16と、この炉芯管14内に雰囲気ガスG

- 3 -

トゾーン中を通過させて脱水し、次いで、発 熱体 1 3 を 1 6 0 0 ~ 1 7 0 0 でまで加熱す ると共に、炉芯管 1 4 内の雰囲気ガスを Ho 雰囲気とし、再びスートは材 1 2 をヒートゾ ーンを通過させ、焼結して、透明な光ファイ パ用ガラス母材を作製する。

<発明が解決しようとする課題>

前述した装置における魔ガス処理部18と して、従来では過式や乾式の魔ガス処理装置 を用いているが、以下のような問題がある。

- (イ) 超式の崩ガス処理装置の場合は、大型であるので散置場所の確保が大変である。
- (回)また、麗式では一般に一台で複数の炉本体15からの路ガスを処理するので、 炉木体15の近傍に配設することができず、排気質21が長くなってしまうとい 5四額がある。
- (7) このため、排気管21中で廃ガスの SiO₂ 粉末が生じてしまい、SiO₂ 粉末に より、排気管21がつまってしまうとい

を供給するガス供給部17と、上配炉芯管14 より排出される魔ガスを処理する魔ガス処理 部18とから構成されている。

この基置を用いてスート母材 1 2 を脱水焼 精するには、該スート世材12を昇降手段16 のシード権19を介して炉芯管14内に押入 後、炉芯管14の上蓋14aを閉める。そし 加熱すると共に、ガス供給部17よりガス導 入竹20を介して該炉芯幣14内に雰囲気ガ スGを導入する。この雰囲気ガスは例えばHe とSiCt。との視合ガスを用いており、SiCt。 の濃度が2~8%となるような割合としてい る。また炉芯管14のガス排気口から排出さ れる賭ガスは排気質21を介して廃ガス処理 部18へ送られ、ててで処理される。尚、簸 廃ガス処理部18は他の脱水焼精装置からの 魔ガスをも導入し、ことで一括処理するよう にしている。

このような状態で、スート母材12をヒー

- 4 -

う問題がある。

(3) 一方の乾式の魔ガス処理装置は、炉本体 1 5 の近傍に散魔することはできるものの、脱水焼結時のように多量の魔ガスを処理する必要がある場合には、ランニングコストが削高になるという問題があ

本発明は、以上述べた事物に鑑み、炉芯管からの魔ガスを効率よく処理して、排気管中にSiO₂ 粉末が堆積してつまることがない多孔 質許純度石英母材の脱水焼結装置及び多孔質 高純度石英母材の脱水焼精力法を提供することを目的とする。

<課題を解決するための手段>

前記目的を達成するための本発明にかかる 多孔製高純度石英母材の脱水焼結装躍の構成 は、光ファイバ用の多孔質高純度石英母材を 脱水焼結する発熱体及び炉芯管を有する炉本 体と、この炉芯管内に雰囲気ガスを供給する ガス供給部と、この炉芯管より排出される魔 ガスを処理する別ガス処理部とを具備する多 孔製高純度石英母村の脱水焼結装置において、 炉本体と腕ガス処理部とを連結する接続手段 に、大気を導入する大気導入部と、この大気 導入部から導入した大気及び廃ガスを加熱す る加熱手段と、別ガス中の反応により生成し た粉体を収集する集盛部とを設けてなること を特徴とする。

また、一方の多孔質高純度石英母材の脱水 処理方法の構成は、炉芯管内に少なくとも一 定時間 Si C 4。を含む雰囲気ガスを導入しつ つ多孔質高純度石英母材を加熱して脱水焼結 すると共に、炉芯管より排出される廃ガスを 処理する多孔質高純度石英母材の脱水焼結方 法において、上記脱水焼粕反応により炉芯管 から排出される Si C 4。を含む雰囲気ガスを 廃ガス処理部で処理する Q 前に、 該排出雰囲 気ガス中の Si C 4。を 酸化又は加水分解させて Si O 。 粉体とした後、この Si O 。 粉体を収盛 除去することを特徴とする。

- 7 -

銀盛部103とを具備してなるものである。

上記加熱手段 1 0 2 は 導入した大気と崩ガスとを共に加熱して下記に示す反応の活性化を向上させるもので、加熱温度は約800~1200で程度とするのが譲ましい。

ととで、関ガス中に含まれるSiC4。をSiO。 粉末化させる加水分解反応及び酸化反応の反 吃式を次に示す。

·加水分解反応

SiCℓ₄+2H₂O → SiO₂+4HCℓ ···(1) . 酸化反応

 $SiC\ell_4+O_2 \rightarrow SiO_2+2C\ell_2 \cdots (2)$

上記反応において加水分解反応(川の方が酸化反応(2)よりも、SiO₂ 粉末を生成しやすいので、加水分解反応(川を促進させるために、大気を導入する大気導入部101に加湿手段104を設けて水分含量の多い大気を排気管21内に導入することが領ましい。

次に、SiCe から上記反応によって生成したSiO2 初末を効率よく収集するための、発展

<作 用>

炉本体からの排出ガス中のSiCℓ。は大気又は水分により反応し、SiO。粉末となると共に 線塵部により収集除去され、下流側の排気管 内にSiO。の付着することはない。

<奖 施 例>

以下、本発明の好適な一実施例を図面を参照しながら詳しく説明する。

第1図には本実施例にかかる多孔質高純度 石英母材の脱水燃結装置の概要を示す。なお、 従来技術にかかる第3図に示す装置と同一の 部材には同一符号を付して重複する説明は省 略する。

第1 図に示すように、本実施例にかかる脱水焼結裝置100には、炉本体15 と廃ガス処理部18とを連結する接続手段としての排気管21に、大気を導入する大気導入部101と、この大気導入部101から導入した大気及び路ガスを加熱する加熱手段102と、廃ガス中の反応により生成した粉体を収集する

- 8 -

部 1 0 3 の構成を第 2 図を参照して説明する。 第 1 図,第 2 図に示すように、集盛部 1 0 3 は上蓋 1 0 5 とトラップ部 1 0 6 とから構成 されており、加熱手段 1 0 2 と處ガス処理部 1 8 とを連結している排気管 2 1 に介装され て設けられていて、ここで加熱手段 1 0 2 に よって活性化されて生成した SiO2 粉末をトラップ部 1 0 6 で収集している。この集 應部 1 0 3 の上蓋 1 0 5 の上面 1 0 5 aには炉芯管 1 5 から連通する排気管 2 1 が連結されており、 この排気管 2 1 から魔ガスが導入されている。 一方、該集機部 1 0 3 の上蓋 1 0 5 の側面 1 0 5 b には魔ガス処理部 1 8 に連通する排気管 2 1 が連結されている。

そして、上番 1 0 5 の上面 1 0 5 a から導入された廃ガスは、上番 1 0 5 の下部にバッキン 1 0 7 を介して取り外し自在に設けられたトラップ部 1 0 6 内に設けられた、例えばアルミニウム合金製の金網 1 0 8 で SiO, 粉末を集盛させ、その後 SiO。粉末が除かれた廃ガ

スのみを崩ガス処理部18へ送るようにしている。

<試験例>

第1図に示す脱水処理装置を用いて 1 0 0 本のシングルモ…ド光ファイ バ用の多孔 質高 純度石英母材を脱水・焼結した。

尚、集盛部103のトラップ部106は2 組用息しておき、石英母材を2~3本脱水焼 結した後に、そのつと交換して収集したSiO。 粉末を除去した。

100本脱水焼結後、排気管21を4ケ所 分解してその内壁を調べた。その結果排気管 21の内壁内には、SiOg粉末が付着していた ものの、種っている状態ではなかった。

尚、比較例として従来の第3図に示す装置を用いて同様に脱水焼結し、100本終了時で排気管21内を調べた。その結果、分解した4ヶ所で、それぞれSiQ、粉末が3mm,7mm,3mm,2mm推積していた。7mm推積している所はパルブ部であり、パルブの関閉が難しい

状態であった。また計算によれば、完全に排 気管内がつまるまでには、約130本の処理 が可能であるが、その前に配管の圧損が上昇 し、使用不能となることが想定される。

<発明の効果>

以上、実施例,試験例とともに詳しく述べたように本発明によれば、廃ガス処理部で別ガスを処理する以前に廃ガス中の粉末を収集することとしているので、排気管内に粉末がつまることがなくなり、長期間に至って定して多孔関高純度石英母材の脱水・焼精を行うことが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の好遊な一実施例にかかる多 孔質高純度石英母材の脱水焼結装置の概略図、 第2 図は集盛部の概略図、第3 図は従来技術に かかる多孔質高純度石英母材の脱水焼結装置の 概略図である。

図 画 中、

11,100は多孔質高純度石英母材の脱

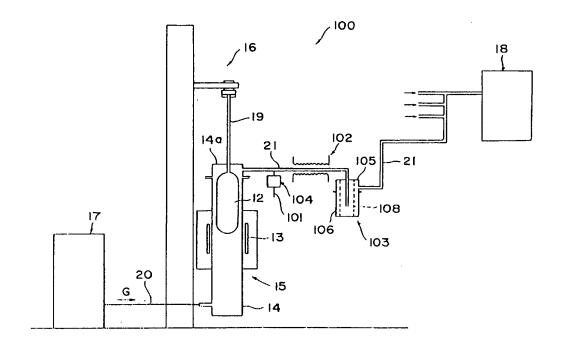
- 11 -

水烧精装置、

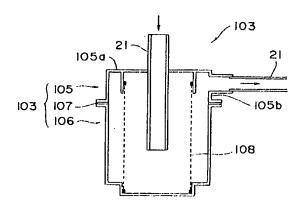
- 12はスート母材、
- 13世銷熱体、
- 14世炉芯智、
- 15は炉本体、
- 16は昇降手段、
- 17はガス供給部、
- 18は魔ガス処理部、
- 19はシード棒、
- 20 はガス導入官、
- 2 1 は排気賃、
- 101は大気導入部、
- 102は加熱手段、
- 103以集盛部、
- 104は加湿手段、
- 1 0 5 は上蓋、
- 106はトラップ部、
- 107は11ッキン、
- 108は金襴である。

- 12 -

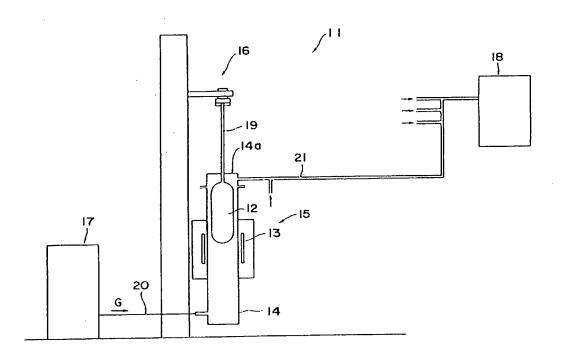
第 | 図



第 2 図



3 図 第



第1頁の続き

明者

@発

Ш 真 @発 明 者 石

大

賀

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内 裕

神奈川県横浜市栄区田谷町 1 番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内